課題に関する情報

- 課題責任者名: 篠原 佑也
- 所属:東京大学大学院新領域創成科学研究科物 質系専攻博士2年
- 利用ビームライン: BL40XU
- 課題番号: 2006A-1570
- 課題名:時分割×線スペックル測定を用いたゴム中でのフィラー凝集不均一構造の研究

1 研究の目的および背景

ゴムにカーボンブラックやシリカなどのフィラー を充填すると、粘弾性特性、破断強度などが向上す る補強効果が知られている。しかしその起源につい ては補強効果の発見以来100年間、精力的に研究が 行われているにも関わらず、未だに明らかではない。 TEM 観察や電気伝導率測定などから、フィラーはゴ ム中で一次凝集構造,二次凝集構造などの階層構造 を形成していることが明らかとなっている(図1)。 ゴムを延伸させた場合の粘弾性特性には、この凝集 構造が重要な寄与を果たしていると考えられている。 我々はこれまでにSPring-8のBL20XUとBL40B2を 用いてフィラー充填ゴムの二次元極小角X線散乱と 二次元X線小角散乱の時間分割測定を行い、フィラー 凝集構造と粘弾性特性とが密接な関係を持っている ことを明らかにしてきた。この研究においてフィラー の種類や体積分率によってゴム中での凝集構造が異 なることが明らかになっている。ゴムの補強効果を



☑ 1: Hierarchical structure of filler in rubber

理解する上では、これらの凝集構造形成過程や凝集 構造の周波数応答特性に関する知見が重要である。 しかしマクロな物性評価を通じて凝集構造の周波数 応答特性を研究する試みは行われているものの、実 際にフィラーがゴム中でどのように凝集構造を形成 するのか、フィラー凝集構造がどのような周波数応 答特性を持っているのかといった知見はほとんど得 られていない。そこで本研究ではX線光子相関法を 用いてフィラー充填ゴム中でのフィラーのダイナミ クスを測定することを目的に研究を行った。X線光 子相関法 (X-ray Photon Correlation Spectroscopy: XPCS)はX線領域での動的光散乱であり、従来の可 視光レーザーなどを使用した動的光散乱では測定で きない不透明な試料やフィラーの密度が濃厚な系の ダイナミクスにも適用できると考えられる。

2 実験手法

2.1 XPCS の測定条件

XPCS を行う上で満たすべき光学系の条件は次の 通りである。

1. 試料位置でのビームサイズDは空間コヒーレン ス長 ξ_T よりも小さくなければならない。

- 2. 異なる経路を通った散乱の経路長が時間コヒー レンス長 ξ_L よりも小さくなるような試料厚み d、ビームサイズ L_T でなければならない。
- 3. 検出器の空間分解能 A が、スペックル特有の粒 状パターンの大きさよりも小さくなければなら ない。

空間コヒーレンス長 ξ_T は X 線の波長 λ と光源のサ イズ S、光源と観測点との距離 R_s を用いて、

$$\xi_T = \frac{\lambda R_s}{S} \tag{1}$$

と書ける。BL40XUの光源サイズは800 μ m (H) × 20 μ m (V)であり、光源とハッチの試料部との距離は48 m である、したがって λ = 1.24 Å で実験を行うと、空間コヒーレンス長は7.4 μ m × 29.6 μ m となる。したがって数ミクロン径のピンホールを試料より上流に設置してX線マイクロビームを生成することで、完全ではないにしても部分的にコヒーレントなX線が得られる。通常、ピンホールを用いてX線マイクロビームを生成すると得られるX線の光子数が小さくなる。したがってXPCSのようにミリ秒オーダーの露光時間でX線の強度揺らぎを正確に測定するためには、BL40XUのような大強度なビームラインが必要不可欠である。

一方、時間コヒーレンス長は、

$$\xi_L = \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda} \right) \tag{2}$$

と書ける。BL40XU にはモノクロメーターがなく、 helical undulator を用いた pink beam であるため、 $\Delta\lambda/\lambda = 1.8 \times 10^{-2}$ であり、時間コヒーレンス長は 34.4 Å と決して長くはない。異なる経路を通ったX 線の経路差が時間コヒーレンス長よりも短くなるた めには、

$$\xi_L > 2t \left(\frac{\lambda}{4\pi}q\right)^2,$$

$$\xi_L > \frac{\lambda}{2\pi}qD$$
(3)

という条件を満たす必要がある。ここで *D、t* はそ れぞれビームサイズと試料厚みである。いま、試料



☑ 2: Schematic view of experimenta setup at BL40XU, SPring-8.

厚みをt = 1 mm、波長を $\lambda = 1.24 \text{ Å}$ 、試料位置での ビームサイズを $D = 3 \mu \text{m}$ とすると、上の条件はそ れぞれ、

$$q < 1.33 \times 10^{-2} \text{ Å}^{-1}$$

$$q < 5.8 \times 10^{-3} \text{ Å}^{-1}$$
(4)

となるので、小角領域の散乱を測定すればよいこと がわかる。

2.2 実験配置

実験配置の模式図を図2に示す。試料より15cm 上流に3-4μmφのピンホールを挿入し、試料位置で 数ミクロン径のX線マイクロビームを生成した。こ のピンホールからのフラウンホーファー回折や上流 からの寄生散乱は、ピンホールと試料の間に別のピ ンホールを設置することで除いた。試料は LINKAM 社製の温度コントロールステージに設置した。試料 から3m 程度下流に X-ray Image Intensifier (XRII) と組み合わせた CCD 型 X 線検出器 [1] を設置した。 ここで用いている XRII は従来の小角 X 線散乱実験な どで用いられているものとは異なり、像の縮小機能 はついておらず、像の強度増倍のみを行う。したがっ て空間分解能を比較的高く保ったまま検出器の実効 的な感度を向上させている。ただし、XRII と CCD の間のリレーレンズは3種類の倍率(×1,×2×0.5) のものが使用可能であり、必要な視野に応じて選択 することが可能である。CCD としては浜松ホトニ クスの C4880-80 を用いた。CCD のピクセルサイズ は 9.9 µm であるが、XRII での像の広がりがあるの



🖾 3: Beam profiles measured by Ta knife edge. The thickness of the Ta knife edge was $100 \,\mu$ m.

で、実効的な空間分解能は 50 µm 程度である。波長は 1.24 Å とした。

試料としては、カーボンブラックを充填したスチ レンブタジエン未加硫ゴムを用いた。別途、小角X 線散乱の結果から、散乱として観測されているのは ゴムではなくフィラーの構造であることがわかって いる(厳密にはゴムとフィラーの電子密度差である が)。従って、観測される散乱強度の揺らぎはフィ ラーの構造揺らぎに対応している。

試料の温度は 30 - 150 °C の範囲で数点選び、各温 度において 73 ms の露光時間で 200 秒/枚で 1500 枚 程度、連続測定をおこなった。得られた散乱像は入 射 X 線強度について規格化した後、各ピクセル毎に 時間相関関数を計算し、さらに q が等しいものにつ いて方位角平均した。

3 結果と考察

図3に100 μ mのTaナイフエッジで測定した試料位 置でのビームサイズを示す。半値全幅で4.4 μ m (H)× 3.4 μ m (V)、強度が10%になるところでの全幅は 7.5 μ m (H)×6.25 μ m (V)であった。空間コヒーレン ス長は7.4 μ m (H)×29.6 μ m (V)であるので、試料位



☑ 4: Typical speckle image.

置でのビームサイズは XPCS を行う条件を満たして いることがわかった。

図4に、本実験で測定された散乱像の例を示す。ス ペックル特有の粒状の散乱が観測されていることがわ かる。ビームストップ近傍の散乱は、 $q = 6 \times 10^{-4}$ Å⁻¹ であり、実空間では 1 μ m 程度の大きさに対応して いる。また、検出器の端はほぼ $q = 6 \times 10^{-3}$ Å⁻¹ 程 度であり、前述の XPCS が測定される条件(時間コ ヒーレンスに関する条件)を満たしている。

実際の測定に入る前に、ビームの位置安定性につ いて測定した結果を図 5、6 に示す。それぞれ DSS を開けてからすぐに測定を開始した。ビーム位置は 図 4 のような散乱像のデータから重心値を求めたも のである。従って、必ずしもビームの重心値そのも のではないこと、及びビームの強度揺らぎに影響さ れることを付記する。測定時間が短い場合(図5)に は縦、横ともにほとんどビームの位置変動がないこ とがわかる。それに対して、測定時間が長くなると (図 6)次第にビームの位置が変動する様子が観察さ れた。このビーム位置変動は、DSSを開いてから 20 分程度の時間をおくと安定することがわかった。ビー ムの振動の要因としては、

1. SR リングの電子軌道の位置変動

2. マイクロビームを生成しているピンホールの位



☑ 5: Beam position at detector measured by beam monitor

置変動

3. BL40XU 上流のミラーの変動

の3つが主に考えられる。SRリングの電子軌道の 位置変動については、DSSの開閉とは因果関係はな く、また実際に、本実験で観測された検出器位置で のビーム位置変動との相関は見られなかった。一方、 本実験課題中は MBS は開けたままにしており、ミ ラーには常にX線が照射していることがわかる。し たがって、DSSの開閉でミラーにかかる熱負荷は変 わらないので、ミラーの変動がビームの位置変動の 要因になっているとも考えられない。したがって、X 線の照射によりピンホールにかかる熱負荷が大きく なり、なんらかの位置変動が起こったと考えるのが 妥当である。実際の測定では試料への照射ダメージ や検出器への負荷を考え、試料直前に別の手動シャッ ターを導入し、本測定前に20分程度ピンホールにX 線を照射することでビーム位置を安定させた。

次に、図4のあるピクセルを選び、そのピクセル で観測された強度揺らぎの試料温度依存性を図7に 示す。図から明らかなように、試料が低温の場合に は散乱強度揺らぎもゆっくりとしており、試料の温 度の上昇とともに、揺らぎの速さが早くなることが 観測される。実際の解析では、このような揺らぎス ペクトルの自己相関関数を各ピクセル毎に算出し、 さらに同じqで方位角の異なるピクセルから得られ



☑ 6: Beam position at detector measured by XRII-CCD

た自己相関関数を平均することで、各サイズにおけ る強度揺らぎの自己相関関数を算出する(図8)。こ の図からも、散乱強度の揺らぎが試料温度の上昇と ともに速くなっていることがわかる。

本実験で観測された強度揺らぎは、試料中でのナ ノ粒子(この場合にはカーボンブラック)の構造揺 らぎに直接対応している。したがって、本測定から 温度上昇とともにゴム中でのナノ粒子の動きが速く なっていることがわかった。これは非常に当然の結果 ではあるが、これまでゴム中でのナノ粒子のダイナ ミクスについて、このように直接ダイナミクスを測 定する手法はなかった。したがって、マクロな粘弾性 特性とミクロな構造揺らぎとを関連づけようとする 理論はあるものの、ミクロな構造揺らぎについての 実験的知見が非常に限られていた。本研究は XPCS がミクロな構造揺らぎの測定において重要な役割を 果たし得るということを示しており、今後、XPCSの 測定技術、解析技術を発展させていくことで様々な ミクロ構造揺らぎとマクロな物性との関連が解明さ れることが期待される。

本ビームタイム中に、

 試料温度だけではなく、カーボンブラック充填 量、ゴムに充填するナノ粒子の種類、ゴムの加 硫の有無によりゴム中のフィラーダイナミクス が変わる



☑ 7: Typical scattering intensity fluctuation.



図 8: Typical autocorrelation functions of scattering intensity fluctuation.

構造揺らぎの様子は従来の動的光散乱で広く研究されているような拡散過程(Brown 運動)とは異なる過程である

ことが明らかになったが、紙面の都合上、詳細は省 略する。今後、さらに実験及び解析を行い、ゴム中 でのフィラーダイナミクス、さらにはフィラー充填 ゴムのマクロな粘弾性特性との関係を明らかにして いきたい。

Acknowledgment BL40XU における XPCS 実験 は JASRI の八木直人博士、井上勝晶博士、太田昇博 士に様々な面で協力して頂いた。また、本研究は SRI 研究開発(株)の岸本浩通氏との共同研究である。指 導教官である東京大学大学院新領域創成科学研究科 の雨宮慶幸教授には私がこのような新規研究を自由 に行うことのできる環境を与えて頂き、また有益な 議論をしていただいた。以上の方々に深く感謝する。

参考文献

 Y. Amemiya *et al.*, *Rev. Sci. Instrum.*, **66**, 2290-2294 (1005).